

УДК 621.315.592

©1995

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ МЕТАЛЛ-ИЗОЛЯТОР В СИЛЬНО ЛЕГИРОВАННЫХ КОМПЕНСИРОВАННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ (СЛКП)

М.И.Даунов, И.К.Камилов, В.А.Елизаров

Институт физики Дагестанского научного центра
Российской академии наук,
367003, Махачкала, Россия
(Поступила в Редакцию 7 декабря 1994 г.)

Получен уточненный критерий перехода металл-изолятор в сильно легированных компенсированных полупроводниках (СЛКП) и показано, что корреляция в расположении заряженных примесей понижает критическую концентрацию носителей заряда. Выяснено, на примере СЛКП n -InSb, что коэффициент $K_c = 1 - n_c/N_d$ (где n_c — критическая концентрация электронов, N_d — концентрация доноров) в области промежуточного легирования проходит через минимум.

Для определения критической концентрации носителей заряда перехода от металлической проводимости к активационной (МА-переход), происходящего под действием компенсации в результате локализации носителей заряда в крупномасштабные флуктуации случайного потенциала, например, в полупроводнике n -типа, предлагается [1,2] и применяется [3] соотношение

$$n_c = 0.42N^{2/3}a^{-1}, \quad (1)$$

где $N = N_d + N_a$, N_d и N_a — концентрации доноров и акцепторов, a — боровский радиус. Соотношение (1) выведено из условия равенства энергии Ферми ε_F и среднеквадратичного потенциала флуктуации концентрации примесей $\bar{\gamma}$, полученного в приближении линейного экранирования, с использованием плотности состояний в однородном полупроводнике с квадратичным изотропным законом дисперсии $g_0(\varepsilon) \sim \varepsilon^{1/2}$. Как будет показано далее, в таком приближении коэффициент $\beta = n_c N^{-2/3} a$ и соответственно n_c завышены более чем на порядок.

Более точно n_c можно оценить, воспользовавшись плотностью состояний, полученной в рамках теории линейного экранирования [2]. Применяя линейную аппроксимацию для плотности состояний, получим

$$n_c = (2/\pi)^{10/9} - [\delta_c(0.044 + 0.15\delta_c)]^{8/9} N^{2/3} a^{-1}, \quad (2)$$

где $\delta_c = \varepsilon_p/\bar{\gamma} = \varepsilon_F/\bar{\gamma}$, ε_p — уровень протекания [1,2]. Здесь и далее энергия отсчитывается от условного нуля на расстоянии типичного значения флуктуации потенциальной энергии электрона.

Воспользуемся полученной в [4] в приближении нелинейного экранирования плотностью состояний

$$g(\varepsilon) = g_0(\gamma)(\varepsilon/\gamma)^{7/2} \quad (3)$$

в окрестности невозмущенного дна зоны проводимости в интервале энергии порядка типичного значения амплитуды случайного потенциала

$$\gamma = (e^2/\chi)(N^{2/3}/n^{1/3}) \quad (4)$$

(χ — диэлектрическая проницаемость) масштаба $r = N^{1/3}/n^{2/3}$. Отсюда

$$n_c = 2(3\pi)^{-4/3}\delta_c^3 N^{2/3}a^{-1}, \quad (5)$$

где $\delta_c = \varepsilon_F/\gamma_c = \varepsilon_p/\gamma_c$. Соотношение (5) следует из $n_c = \int_0^{\varepsilon_p} g(\varepsilon)d\varepsilon$ и (3), (4). В [1] в формуле (5) стоит $\delta_c^{4/3}$, так как вместо $g(\varepsilon)$ использовано $g_0(\varepsilon)$, а вместо γ_c — параметр $\bar{\gamma}$.

Зависимость $g \sim \varepsilon^{7/2}$ в (3) выведена при больших ε . Однако в [4] показано, что значения энергии Ферми в капле при температуре абсолютного нуля $\varepsilon_F^{(d)}$, вычисленной с использованием (3) и в [1], совпадают. На основании этого в [4] сделан вывод о применимости (3) во всем интервале энергий от нуля до γ . Кроме того, из отношения $\varepsilon_F^{(d)}/\gamma_c = \delta_m$ следует $\delta_c \approx 2.15\delta_m$ и $\varepsilon_p > \varepsilon_F^{(d)}$, т.е. ε_p попадает в интервал энергий $\varepsilon_F^{(d)} < \varepsilon < \gamma_c$, для которого выведено (3).

Для коэффициента β формулы (1), (2) и (5) дают соответственно при $\delta_c = 1$ значения 0.42, 0.14 и 0.1, а при $\delta_c = 0.5$, согласно (2), (5), β равняется 0.05 и $1.26 \cdot 10^{-2}$.

Итак, критерий (1) существенно завышает n_c в связи с использованием плотности состояний $g_0(\varepsilon)$ и из-за предположения, что ε_p равняется среднему значению флюктуирующего потенциала, т.е. уровень протекания располагается у края бывшего дна зоны проводимости [1]. Очевидно, наиболее приемлем критерий (5), выведенный в приближении $\delta \ll 1$, поскольку, как будет показано далее, $\delta_c < 1$. Уместно отметить, что квазиклассическое описание применимо при произвольном δ [1, 2].

Коэффициент δ_c можно оценить в предположении

$$\varepsilon_F = \varepsilon_p = \gamma_c - \Delta\varepsilon, \quad (6)$$

где $\Delta\varepsilon$ — расстояние между невозмущенным и опущенным в результате перестройки энергетического спектра вследствие сильного легирования краем зоны проводимости. Подавляя в (6) значения γ_c и используя (5), имеем

$$\delta_c^{-1} = 1 + \left\{ [(3\pi)^{4/3}/2]S(1+K_c)^{4/3}N_d^{1/3}a \right\}^{-1/3}, \quad (7)$$

где $S = (e^2/\chi\Delta\varepsilon)^3N_d$, $K_c = 1 - n_c/N_d$, e — заряд электрона. Параметр $\Delta\varepsilon$ можно определить из экспериментальных данных [5—7] или теоретических расчетов [5, 8].

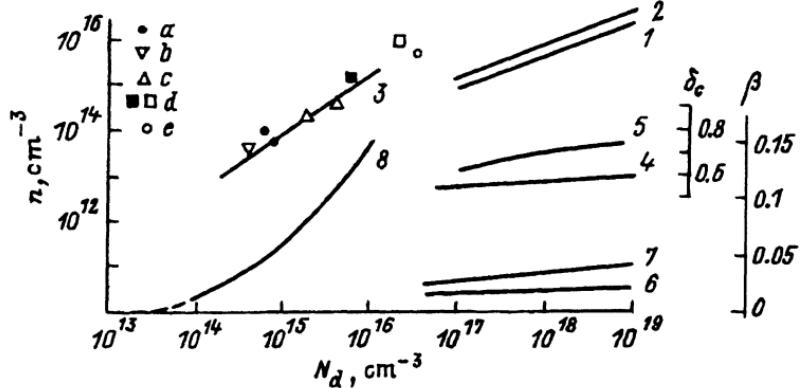


Рис. 1. Зависимость критической концентрации электронов n_c (1–3), коэффициентов δ_c (4, 5) и β (6–8) от концентрации доноров в n -InSb.

Кривые 1, 4, 6 рассчитаны по (5), (8), 2, 5, 7 — по данным [5] и (5), (7). Кривые 3, 8 и значения — эксперимент: а — [9], б — [12], с — [13], д — [10], е — [14]. Светлые значения — $n > n_c$. Кривая 8 — эффективное значение коэффициента β .

Учитывая слабую зависимость ε_p от компенсации [9, 10], напряженности магнитного поля [3] и всестороннего давления [11], а также, как будет показано далее, от корреляции в расположении заряженных примесей и полагая $1 + K_c = 2$, $\Delta\varepsilon = \bar{\gamma}$, где $\bar{\gamma}$ определяется концентрацией основных примесей, получим

$$\delta_c^{-1} = 1 + 0.856(N_d^{1/3}a)^{-1/12}, \quad (8)$$

$$\Delta\varepsilon = (e^2/\chi)(2\pi)^{1/2}(N_d^{1/3}a)^{1/4}N_d^{1/3}. \quad (9)$$

На рис. 1 приведены вычисленные по (5), (7), (8) значения n_c , δ_c и β в зависимости от N_d в n -InSb.

Соотношение (9) удовлетворительно согласуется с данными о величине сдвига края оптического поглощения в СЛКП по отношению к нелегированному образцу [5–7].

Поскольку $\delta_c = 1 - \bar{\gamma}/\gamma$, где γ — типичная амплитуда случайногопотенциала, формируемого, вообще говоря, как в случае пуассонского распределения, так и при коррелированном расположении заряженных примесей, а также структурными дефектами, то корреляция, понижая γ до γ_i с масштабом $r_i < r$, неизбежно должна привести к снижению β и n_c . Этот вывод подтверждается характеристиками МА-перехода в СЛКП $CdSnAs_2(Cu)$, происходящего под воздействием всестороннего давления [11]. В этом соединении рост давления сопровождается усилением компенсации. Это в свою очередь обусловливает рост γ до $\gamma > \gamma_i$, и МА-переход происходит в условиях коррелированного расположения заряженных примесей. В образце $CdSnAs_2(Cu)$ [11] с $N = 2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $K_c = K_a = N_a/N_d \simeq 1$ МА-переход наступает, когда $n_c = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ и $\Delta\varepsilon = 0.03 \text{ eV}$. Действительно, экспериментально полученная величина $\Delta\varepsilon$ согласуется со значением, найденным согласно (9), а параметры $r_i = 10^{-5} \text{ cm}$, $\gamma_i = 36 \text{ meV}$, $\delta_{ic} = 0.18$, определенные по n_c , $\Delta\varepsilon$ и (3), оказались меньше вычисленных без учета корреляции (для $N = 2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, согласно (5), (8), (4), получены $n_c = 5.7 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$,

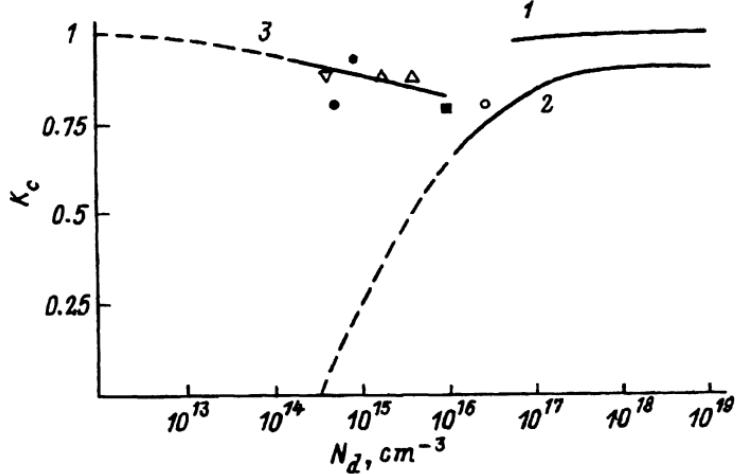


Рис. 2. Фазовая диаграмма МА-перехода в СЛКП n -InSb; зависимость $K_c = 1 - (n_c/N_d)$ от N_d .

Сплошные кривые 1, 2 рассчитаны соответственно по (5), (1). Сплошная кривая 3 и звочки — эксперимент. Обозначения те же, что на рис. 1. Штриховые линии — экстраполяция.

$\delta_c = 0.56$, $\beta = 1.8 \cdot 10^{-2}$, $r = 3.7 \cdot 10^{-5}$ см и $\gamma = 72$ мэВ). Корреляцию можно характеризовать введением эффективной величины концентрации ионизированных примесей, вычисленной с использованием γ_i и n_c по (4). Для обсуждаемого образца 2 $N_{\text{eff}} = 2 \cdot 10^{16}$ см $^{-3}$. Очевидно, при корреляции всегда $N_{\text{eff}} < N$. Подчеркнем актуальность вышеприведенного обсуждения, поскольку в СЛКП наличие корреляции в распределении заряженных примесей вследствие образования комплексов является скорее правилом, чем исключением.

Известно [1,2] (это следует из соотношений (1), (2), (5)), что с ростом N_d в СЛКП коэффициент K_c растет. Однако из экспериментальных данных, например, в n -InSb (рис. 1, 2) в переходной области от $N_d = N_M$ ($N_M^{1/3}a = 0.25$; в n -InSb при несколько меньших значениях N_M [11]) до $N_d^{1/3} \approx 1$ следует обратная зависимость K_c от N_d

$$n_c = N_d(-0.7 + 5.35 \cdot 10^{-2} \lg N_d). \quad (12)$$

В минимуме функции $K_c = (N_d)$ $N_d = 10^{16}$ см $^{-3}$, $K_c = 0.83$. На диэлектрической стороне перехода, очевидно, $n_c = 0$ и $K_c = 1$ (рис. 1, 2). В окрестности критической точки $N_d = N_M$ коэффициенты $K_l = n_l/N_d$ (n_l — концентрация электронов, локализованных на донорах) и $K_a = N_a/N_d$ изменяются скачкообразно. С ростом $N_d K_l$ убывает от $K_l \lesssim 1$ до нуля, K_a возрастает от $K_a \gtrsim 0$ до единицы, а $K_c = K_l + K_a$ плавно убывает от единицы к минимальному значению вблизи $N_d^{1/3}a \approx 1$ и далее растет согласно теории СЛКП [1,2] (рис. 2). Эффективный коэффициент β в окрестности критической точки возрастает от нулевого значения с ростом N_d (кривая 8 на рис. 1).

Очевидно, экстраполяция (1) в приближении $K_c = K_a \rightarrow 0$ при $N_d \rightarrow N_M$ в [3] (кривая 2 на рис. 2) неадекватна реальной ситуации.

Знание $K_c(N_d)$, вероятно, окажется полезным при подборе кристаллов для соответствующих исследований. В целом, можно надеяться, что полученные результаты будут способствовать уточнению критерия МА-перехода в СЛКП, происходящего под действием магнитного поля [15].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Список литературы

- [1] Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. ЖЭТФ **60**, 2, 867 (1971); **61**, 2(8), 816 (1971).
- [2] Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М. (1979). 416 с.
- [3] Цидильковский И.М. УФН **152**, 4, 583 (1987); Электронный спектр бесщелевых полупроводников. Свердловск (1991). 224 с.
- [4] Гуляев Ю.В., Плесский В.П. ЖЭТФ **71**, 4(10), 1475 (1976).
- [5] Stern F., Dixon J.R. J. Appl. Phys. **30**, 2, 268 (1959).
- [6] Пенцов А.В., Словодчиков С.В. ФТП **9**, 7, 1233 (1975).
- [7] Батукова Л.М., Данилов В.И., Звонков Б.Н., Карпович И.А. ФТП **16**, 6, 99 (1982).
- [8] Келдыш Л.В., Прошко Г.П. ФТТ **5**, 12, 3378 (1963).
- [9] Яременко Н.Г. ФТП **9**, 5, 840 (1975).
- [10] Гершензон Е.М., Ильин В.А., Куриленко И.Н., Литвак-Горская А.Б. ФТП **9**, 7, 1324 (1975).
- [11] Камилов И.К., Даунов М.И., Елизаров В.А., Магомедов А.Б. ЖЭТФ **104**, 1(7), 2436 (1993); Письма в ЖЭТФ **54**, 10, 589 (1991).
- [12] Putly E.H. Semiconductors and Semimetals. N.Y. (1966). V. 1. P. 289.
- [13] Somerford D.J. J. Phys. Ser. C. **4**, 1570 (1971).
- [14] Аронзон Б.А., Чумаков Н.К. ФТТ. **31**, 4, 10 (1989).
- [15] Шкловский Б.И., Эфрос А.Д. ЖЭТФ **64**, 6, 2222 (1973).